

先端研究施設共用イノベーション創出事業【産業戦略利用】
「安定同位元素イメージング技術による産業イノベーション」利用成果報告書

北海道大学 創成科学共同研究機構長 殿

下記の通り、利用成果を報告します。

申請組織名	京セミ株式会社			
申請代表者	氏名	西村諭一	役職	シニアエンジニア
	所属部署	第1技術開発グループ		
	所在地	〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 385-31		
	電話番号		FAX 番号	
	メール			
連絡担当者	氏名	西村諭一	役職	シニアエンジニア
	所属部署	第1技術開発グループ		
	所在地	〒061-1405 北海道恵庭市戸磯 385-31		
	電話番号		FAX 番号	
	メール			
	緊急連絡先			
最も近い分野	複数選択可。 <input checked="" type="checkbox"/> ナノテク・材料分野 <input type="checkbox"/> ライフサイエンス分野 <input type="checkbox"/> 環境・エネルギー分野 <input type="checkbox"/> その他()			
課題名	光センサー中のリン打ち込みプロファイルの深さ方向分析			
利用施設名	北海道大学 オープンファシリティ 同位体顕微鏡システム			
利用期間	平成19年11月10日 ~ 平成20年2月29日			
	<input checked="" type="checkbox"/> 報告書公開の延期を希望する。(平成22年2月まで)			

● **利用成果**

【利用の目的・内容】 異分野の方にも理解できるよう簡潔に記述してください。

光センサー機能改善の基礎研究

【成果の概要】

シリコン中リン拡散の深さ方向プロファイルを把握することができました。これにより拡散深さが光センサー特性にどのような影響をもたらすか明確になり、今後のセンサー開発に大きな貢献をはたしたと思います。また他のシリコン光センサーにもこのデータが応用され、各種光センサーの新提案が期待されます。

【社会・経済への波及効果の見通し】 研究成果によってもたらされる知的資産の形成、新技術の創製などを記述してください。

リンの深さ方向プロファイルとセンサー特性との関係を明らかにすることにより、光センサー製品の性能向上を追求し産業応用へと発展させる。

受付日	平成20年6月5日	受付者	坂本
-----	-----------	-----	----